

# ALIGNÉUSE

---

FABRICANT : OAI

---

MODÈLE : 806 MBA

---

## Échantillons

- Taille de photomasques : 177mm (7 po) maximum
- Taille d'échantillons : 5 mm à 150 mm

## Caractéristiques

- Sélection spectrale : broadband, I-line, G-line
- Alignement double face, muni d'un module de nano-stampage

### PROCÉDÉS DE ROUTINE

#### Photolithographie mode contacte

**Sur :** résines positives

- Taille de motif minimal atteinte : 0.7  $\mu\text{m}$
- Épaisseur atteinte : 0.45  $\mu\text{m}$  à 30  $\mu\text{m}$

**Sur:** résines négatives

- Taille de motif minimal atteinte : 1  $\mu\text{m}$
- Épaisseur atteinte : 1.5  $\mu\text{m}$  à 2.5  $\mu\text{m}$

**Sur:** SU8

- Taille de motif minimal atteinte : 1  $\mu\text{m}$
- Épaisseur atteinte : 0.5  $\mu\text{m}$  à 30  $\mu\text{m}$

**Sur:** inversion d'image

- Taille de motif minimal atteinte : 1.5  $\mu\text{m}$
- Épaisseur atteinte : 1.5  $\mu\text{m}$  à 3  $\mu\text{m}$

### PROCÉDÉS DE ROUTINE

#### Photolithographie semi-contacte

**Sur :** résines positives

- Taille de motif minimal atteinte : 2  $\mu\text{m}$
- Épaisseur atteinte : 0.45  $\mu\text{m}$  à 30  $\mu\text{m}$

**Sur:** résines négatives

- Taille de motif minimal atteinte : 2  $\mu\text{m}$
- Épaisseur atteinte : 1.5  $\mu\text{m}$  à 2.5  $\mu\text{m}$

**Sur:** SU8

- Taille de motif minimal atteinte : 3  $\mu\text{m}$
- Épaisseur atteinte : 0.5  $\mu\text{m}$  à 30  $\mu\text{m}$

**Sur:** inversion d'image

- Taille de motif minimal atteinte : 2  $\mu\text{m}$
- Épaisseur atteinte : 1.5  $\mu\text{m}$  à 3  $\mu\text{m}$

## Procédés de routine - autres

- Photolithographie sur pellicule photosensibles déposées par laminage. Offre la possibilité d'utiliser des résines beaucoup plus épaisses (100  $\mu\text{m}$ )

## Procédés en développement

- Nano-stampage assisté par UV